

Сапфир (Al2O3)

**Производитель:**

АО «Диполь Технологии»

Цена:

Цена по запросу

Описание

Сапфир представляет собой многофункциональный кристаллический материал с превосходными свойствами: хорошей термостабильностью, высокой теплопроводностью, высокой твердостью, высоким коэффициентом пропускания в инфракрасном диапазоне длин волн, малым значением диэлектрической проницаемости и высокой химической и термической стойкостью.

Применение

В качестве подложек интегральных микросхем, оптоэлектроники, микроэлектроники сапфир даёт возможность решить задачи повышения надёжности и стабильности параметров электронных устройств при работе в

жёстких условиях эксплуатации (инертность, радиационная стойкость, высокие и низкие температуры, высокие механические нагрузки, ионизирующие излучения и другие).

Подложки используются для эпитаксии полупроводниковых плёнок (Si, GaN, AlGaN и многих других).

Спецификация

Сапфир (Al ₂ O ₃)	
Материал	
Диаметр	50
Толщина	420
TTV	
BOW	
Warp	
Шероховатость рабочей стороны	
LTV	
Шероховатость обратной стороны	
Лазерная маркировка	

Производство: Китай. Также доступны слитки, эпитаксиальные структуры и паттернированные подложки сапфира.